PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-153268

(43)Date of publication of application: 06.06.2000

(51)Int.Cl.

CO2F 1/30 B02C 19/18

CO2F 11/12

(21)Application number: 10-331225

(71)Applicant: EBARA CORP

(22)Date of filing:

20 11 1998 (72)Inventor: HATAKEYAMA MASAKI

KUNITOMO SHINTA

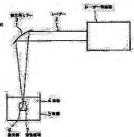
IGARASHI CHIAKI YAMAUCHI KAZUO

(54) TREATMENT OF LIQUID AND DEVICE THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a means for treating liquid, which enables to dehydrate sludge in a high dehydration efficiency without using chemicals, to sterilize without using the chemicals and to treat without using a large

SOLUTION: The liquid treating method is a method for converging laser 2 in a liquid to be treated to cause break down (dielectric break down) in the liquid 4. Plasma, radical. UV light and impulse are generated by the break down and the treatment is performed by the plasma, radical, UV light and impulse. The laser 2 is preferably scanned. As the laser 2, any one of the followings; pulse laser, Q-switching pulse laser, ultraviolet laser or laser exited by sunlight is used. The liquid to be treated is a solution containing bacteria or a solution containing sludge.



(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-153268 (P2000-153268A)

(43)公開日 平成12年6月6日(2000, 6, 6)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
C 0 2 F	1/30		C 0 2 F	1/30		4D037
B 0 2 C	19/18		B 0 2 C	19/18	В	4D059
C 0 2 F	11/12		C 0 2 F	11/12	. Е	4D067

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 11 頁)

(21)出願番号	特願平10-331225	(71)出願人	000000239		
			株式会社在原製作所		
(22)出順日	平成10年11月20日(1998.11.20)		東京都大田区羽田旭町11番1号		
		(72) 発明者	畠山 雅規		
			神奈川県藤沢市本藤沢 4丁目 2番1号 株		
			式会社在原轄合研究所内		
		(72)発明者	國友 新太		
			神奈川県藤沢市本藤沢4丁目2番1号 株		
			式会社在原総合研究所内		
		(100073874		
			弁理士 萩野 平 (外3名)		

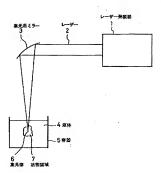
最終質に続く

(54) 【発明の名称】 液体処理方法及び装置

(57) 【要約】

【糠題】 薬品を使用しないで高い脱水効率で汚泥を脱水 水処理したり、薬品を使用しないで穀瘡処理ができると か、大電力を必要とせずに処理することができる液体を 処理する手段を提供する。

【解決手段】 被処理液体にレーザーを収束させて、液体中でプレイクダウン (終報破壊) を起こすことを特徴 とする液体処理方法。プレイクダウン (終報破壊) によってプラズマ、ラジカル、UV光及び衝撃被を発生させ、該プラズマ、ラジカル、UV光及び衝撃をたよって 処理を行う。前記レーザーととてがムスレーザー、Qスイッチングパルスレーザー、紫外線レーザー又は太陽光 励起のレーザーのいずれかを用いる。前記を検理液体が 翻菌が含有している溶液や、汚泥を含有する溶液である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被処理液体にレーザーを収束させて、液体中でプレイクダウン (絶縁破壊) を起こすことを特徴とする液体処理方法。

【請求項2】 ブレイクダウン (絶縁破壊) によってブラズマ、ラジカル、U V光及び衝撃波を発生させ、該ブラズマ、ラジカル、U V光及び衝撃波によって処理を行うことを特徴とする請求項1記載の液体処理方法。

【請求項3】 前記レーザーを走査(スキャニング)する事を特徴とする請求項1又は請求項2記載の液体処理 10 方法。

【請求項4】 前記レーザーとしてパルスレーザー、Q スイッチングパルスレーザー、紫外線レーザー又は太陽 光励起のレーザーのいずれかを用いる事を特徴とする請 求項1~3のいずれか1項記載の液体処理方法。

【請求項5】 前記被処理液体が細菌が含有している溶液であり、前記レーザーにより該細菌を死滅させる処理 を行うことを特徴とする請求項1~4のいずれか1項記載の液体処理方法。

[請求項6] 前記被処理液体が汚泥を含有する溶液で あり、前記レーザーにより該汚泥を分解し、汚泥体積を 減少させることを特徴とする請求項1~5のいずれか1 項記載の液体処理方法。

【請求項7】 前記レーザーにより被処理液体中にある 物体を破砕することを特徴とする請求項1~6のいずれ か1項記載の液体処理方法。

【請求項8】 前記レーザーにより液体に接する容器壁面や建造物壁面への生物付着を抑制することを特徴とする請求項1~6のいずれか1項記載の液体処理方法。

[請求項9] レーザー発生装置、前記レーザー発生装 30 置からのレーザーを、核処理液体中でプレイクダウン (絶縁破壊) を起こすに十分な強度で被処理液体に収束 させる装置を有することを特徴とする液体処理装備。 [祭明の詳細な説明]

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザーを利用して液体中に含まれる汚泥の脱水処理、滅菌処理、スケールや固形物の破砕、また生物付着防止を、多量に効率よく行う技術であり、液体処理技術に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、汚泥の彫水処理においては、下水等の活性汚泥法からの余物汚泥に高分子療集剤を添加し、遠心分療機等により汚形を形水することが行われており、その際汚泥と高分子凝集剤との添加剤合を適正にすることが膨水処理を効率良く行うために必要であるとされている。例えば、特開平5 - 1689 77 号公職では、遠心彫水機内部にフロック汚泥をつくらないようにし、かつ寒注率が多くならないようにするために、流量比率演算機を用い、粘度剤定器を用いて制御しているが、その遠心形水機には特別項の - 206458号公 50

報等に示されている遠心分離機を使用している。

【0003】また、大量の淡水または海水を用いる発電 所や工場では、取水管その他の水管に水生生物が付着し て繁殖し流路面積を狭める。例えば、大量の海水を冷却 水として利用している原子力発電所または火力発電所で は、水生生物が機器、配管および冷却水管に付着し、こ れが成長して繁殖することにより、取水量の減少、熱交 換器やポンプなどの効率低下および損傷などの各種職害 を引き起こしている。そのため、上記のような付着性を 有する各種水生生物の付着、成長および繁殖を防止する ことが必要である。従来行われてきた水生生物の付着防 止方法には、化学的処理方法、物理的処理方法および機 械的処理方法がある。先ず、化学的処理方法としては、 過酸化水素や次亜塩素酸などを用いる薬液注入法、防汚 塗装、電解法および銅イオン法などがある。しかし、こ れらの方法に共通する問題として、使用する化学物質あ るいは生成した化学物質の毒性が指摘され、この毒性に

よる頭連汚狭が間離後されている。
【0004】つぎに、物理的処理方法としては、温水処理法、減水処理法、温原干出処理法、電影法、超音被法、繋音被法、繋が検照射法などがある。しかし、温水処理法、流水処理法は、冷却水系を一時伸止させることは発電ブラントなどでは大きな問題がある。また、電拳法では、水管内全域に約8000℃、両程の電界強度な必要とし、連続処理による消費質力は多大である。超額診法では、水管壁を損傷する可能性がある。機械的処理方法には、マイクロストレーチラなるの端太防止法、水中ロボットによる何を増加生の除去法、スポンジボールやウォータージェットによる付着物生の除去法、スポンジボールやウォータージェットによる行動性の除去法、さらには工具などを使用しての人手による作業法などがある。

【0005】 また、水の殺菌処理に関しては、前記した 紫外線照射法が良く使用されている。紫外線は、水に対 する殺菌剤として知られている。従来では一連の紫外線 パルプのパンクを用意し、処理されるべき水をパルプの 表面上に流すのが一般的であった。この方法には数々の 欠点がある。第一に紫外光の強度がパルブ部の表面から の距離によって変化することである。従って、バルブを 通過する水の全てに対して充分な強度の紫外線を与える ために、バルブを極めて接近して配置したり、あるいは 特別なパルプアレイを用いたりしなければならなかっ た。その様な方法を採ってさえも、バルブを流れる水流 を比較的遅くして、適切な紫外光量が水に与えられるよ うにしなければならなかった。また、パルブを近接して 配置するとかなりの水頭損失を生じた。第2に、バルブ は皮膜が付いたり曇ったりする傾向があるので、これに より紫外光の強度が弱められる。この問題に対する一つ の解決策は、バルプに皮膜が付いた後であってもなお適 切な強度の紫外光が得られるように、紫外光の強度を始

めに必要とされるものよりも増大させることであった。 第三に、懸濁された粒子に付着しているパクテリアは、 この粒子によって光源から遮断されると紫外線にさらさ れない可能性が有ることである。

【0006】殺菌のために現在通常用いられているバル プマはランプに加えて紫外光の光源としては種々のもの がある。謝意領域の光を放射しうる光源の一つとして、 適当に選ばれたレーザー励起ガスによるレーザーがあ る。排水の殺菌のために謝意光を発生させるレーザーを 用いることは従来提案されていなかった。レーザーは、 流速、又は混濁度、有機物質含有量のような水又は他の 液体の特性のような数々の動作上の利点を有する事が判 明した。レーザーは高い強度の紫外光を発生させること ができるから、水の流速を早めることができ、水頭損失 を少なくし、混濁度の高い水に対しても適応し、パクテ リアが紫外光にさらされない可能性を減少させる。 【0007】水処理手段の一つとしては、前記した方法 の他に、水中パルス放電による処理方法が知られてい る。この処理方法は、水中に、電極を設置し、高電圧・ 高電力でのパルス放電を液体中で起こすことにより、付 20 随して発生するプラズマ・UV光・ラジカル・衝撃波に より、水処理を行うものである。これらの、プラズマ・ UV光・ラジカル・衝撃波を用いて、殺菌・汚泥・固体 物破砕等の水処理に用いられる。殺菌・汚泥処理では、 プラズマ・UV光・ラジカル・衝撃波を用いた処理が行 われる。これらの現象を複合的に用いると、効果的な処 理が可能となる。UVだけでは、殺菌や細胞壁破損がさ れにくい微生物では、プラズマ・ラジカル・衝撃波の効 果が重畳されることにより効果的な処理が可能となる。 固体物破砕では、衝撃波を用いた処理となる。一対の電 30 極により発生した衝撃波が、再び別の場所で集束出来る ような容器を用いて、その再集束点に固体物を設置し て、集束された衝撃波によって、該固体物の破砕を行う のである。衝撃波は、集束することにより衝撃波の強度 が高まり、つまり、圧力変動が大きくなり、固体物への 照射時において、圧力変動が大きくなり、破砕される。 【0008】ところで、特開平5-168977号公報 では、前記したように汚泥の脱水技術において、遠心脱 水機を用い、薬注率が多くならないようにするために、 流量比率演算機を用い、粘度測定器を用いて制御してい 40 るが、その汚泥の脱水技術について脱水率をさらに改善 するために、特開平8-57475号公報では、汚泥水 にレーザーを照射し、レーザーにより汚泥の細胞壁を破 壊すれば、それによって汚泥の脱水効率を上げることが できるという提案をしている。また、水の殺菌に関して は、特開昭61-263690号公報の発明は、水の殺 菌においてレーザーを効率的かつ効果的に用いる方法を 示している。紫外線スペクトルを放射するレーザーの殺 菌能力は、副次的な光化学効果よりも主として直接接触 によるパクテリアを殺すことにある。これらの副次的な 50

効果もパクテリアを殺す効果を有するかもしれないが、 製剤工程では、溶極的な効果しか特たない、特開等 に つ 2 6 3 6 9 0 号公報の発明の方法及び装置は特に水の 処理に適するものであるが、水をベースとしたあるいは 水をベースとしない液体を含む一般的な液体の殺菌にも 用いることができる。このように、水処理に関連してレ ーザーを利用しようという試みが盛んにされようとして いる。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】前記の汚泥の脱水においては、凝集剤などの楽品を使用する間被分離方法では、分離され流検は、そのまま排出されるが、固体を含む汚泥は、遠心分離機を通過後も脱水ケーキ中にかなりの水分を含む、現在の脱水機の技術分野では、脱水ケーキの水分の減少は不十分であり、それ以上の減少は現境技術では困難である。これは、汚泥中に存在する微生物の細胞液が残存水分として大きな割合を占めているからで、脱水が困難であることが大きな原因である。

【0010】また、火力発電所等における水生生物の付 着の問題では、装置の大型化、繁雑なメンテナンスの必 要性、細配管内の処理法としての不適正および多大の作 業労力と時間が問題であり、また除去後に生ずる水生生 物を主体とした廃棄物の処理にも苦慮している。従来の レーザー処理技術では、レーザー照射強度が低く、また そのレーザーが照射される箇所も管路流の一部に限られ た処理となっている。例えば、特開平8-164188 号公報の図C-1の様な方式では、11のレーザー透過 窓の大きさ以下でレーザー強度が分布を持った状態での 光照射となってしまう。従って、光照射を受けないもの や弱い照射になる領域が生じる。また、流速が早い場合 には、照射時間が短いので殺菌効果が小さくなる。この 問題の解決では、多数回の旋回によるレーザー照射を行 う必要がでてくるが、そのために装置の大型化が必要と なったり、レーザー強度の到達距離を上げるため、大出 カレーザーが必要となり、高いコストが必要となる。ま た、多数の微生物が存在する状況では、微生物同士が重 なり合った状態でレーザー照射を受ける。従ってはじめ に受けた微生物の殺菌効果は高いが、入射側から見て背 而になっている微生物では、照射強度が下がるために殺 菌効果の現象が起こる。更に、建築物などでは、時間が 立つと、レーザー照射後の流路(レーザーの当たらない 場所) において新たに、微生物の繁殖や輸送が考えられ

[0011] 数菌法についていうと、後来のレーザー光 照射を用いる場合の問題点は、光逸度が低いので殺菌効 果が小さい。また、光が当たった部分しか効果が発揮さ れないので、場所が制約されてしまう。殺菌効果を発揮 するために、紫外線レーザーを用いる影響がある。さら 、水中が凡な海雀による効果特様に払いては、この気 理法では、電極が設置されている付近しか効果がないこと、多量処理のために、多大な電極及び大きな出力電源 が必要となり、高いコストとなる。また、放電時に、電 極材料が溶引出す間距がある。溶出した金融を分離回収 するなどの追加手段がさらに必要となる。また、長時間 の使用により、電極面での汚染物の付着などにより、正 常放電が維持できなくなったりするため、メンテナンス に対して高いコストが掛かる。

【0012】上述したように、解決されるべき要点として以下のことが挙げられる。

汚泥処理:汚泥の脱水処理において、従来、凝集剤等の 薬品を大量に使用しなければならなかった。また、脱水 効率が悪く、汚泥の低水分ケーキを造ることが困難であ った。

また、水中パルス放電の場合では、多量の電極と大電力 量が必要であり、効果領域の制限や電極材料の溶け出し による金属回収後処理工程追加などの複雑工程化があった。

殺菌処理: 紫外線レーザーに限られた使用方法である。 また、光強度が低く、高出力にするためには、非常に高 20 いコストとなる。また、流れがある場での処理なので、 単位流量当たりの照射量・光強度が低く、処理効果が低 い、

【0013】また、水中パルス放電の場合では、多量の 電極と大電力量が必要であり、効果領域の原限や電極材 料のとけ出しによる金属回収後処理工程追加などの複雑 工程化がある。

水生生物(着防止: 従来、機械による方式では、装置の 大型化、繁雑なメンテナンスの必要性、細配階の処理 法としての不適性および多大の作業労力と時間が阻断で あり、また除去後に生ずる水生生物を主体とした廃棄物 の処理にも苦慮している。レーザーによる方法でも、従 来の方法では、処理領域が限られてしまう、また、光強 度が低く、処理領域が限られてしまう、また、光強

固体物酸砕・主に衝撃波を用いた処理となったが、従来 は、水中放電による衝撃波が用いられる。この方法で は、水中放電のための電極が必要で、該電極の溶け出し による水汚染や電極表面の汚染による不安定動作の出現 があり、メンテナンスの傾離さが挙げられる。このよう に、レーザーを適用するに当たってはこれらの問題点を 解消できるようにしなければならない。

[0014]

【課題を解決するための手段】本発明者は、水処理のみならず広く液体処理に有効な手段を検討したところ、レーザーによる処理が共通して用いられているところから、レーザーによる処理では処理効果が小さいという欠点があり、従来この手段は実用化されていなかった。しかし、本発明者は、レーザーによる処理を稼むでいて研究し、レーザーによってアレイクダウン、総縁被策を起こすことに 50

- より大きい処理効果が得られることを見いだし、それに より処理効果が大きいレーザーによる処理技術を開発し たものである。
- 【00.15】すなわち、本発明は、下記の手段により前記の課題を解決した。
- (1) 被処理液体にレーザーを収束させて、液体中でブレイクダウン(絶縁破壊)を起こすことを特徴とする液体処理方法。
- (2) プレイクダウン (絶縁破壊) によってプラズマ、
- ラジカル、UV光及び衝撃波を発生させ、該プラズマ、 ラジカル、UV光及び衝撃波によって処理を行うことを 特徴とする前記(1)記載の液体処理方法。
- (3)前記レーザーを走査(スキャニング)する事を特徴とする前記(1)又は(2)記載の液体処理方法。
- (4) 前記レーザーとしてパルスレーザー、Qスイッチングパルスレーザー、紫外線レーザー又は太陽光励起のレーザーのいずれかを用いる事を特徴とする前記(1)~(3)のいずれか1項記載の液体処理方法。
- 【0016】(5) 前記被処理液体が細菌が含有している溶液であり、前記レーザーにより該細菌を死滅させる 処理を行うことを特徴とする前記(1)~(3)のいず かり項記載の液体処理方法。
 - (6) 前記被処理液体が汚泥を含有する溶液であり、前 記レーザーにより設汚泥を分解し、汚泥体類を減少させ ることを特徴とする前記(1)~(5)のいずれか1項 記載の液体処理方法。
 - (7) 前記レーザーにより被処理液体中にある物体を破砕することを特徴とする前記(1)~(5)のいずれか1項記載の液体処理方法。
- (8) 前記レーザーにより液体に接する容器壁面や建造 物壁面への生物付着を抑制することを特徴とする前記
- (1) ~ (5) のいずれか1項記載の液体処理方法。
- (9) レーザー発生装置、前記レーザー発生装置からの レーザーを、被処理能体中でブレイクダウン (絶縁破 域) を起こすに十分な強値で被処理液体に収束させる装 置を有することを特徴とする液体処理装置。

[0017]

【発卵の実施の形態】 本発明では、液体処理にレーザーを用いる際して、レーザーにより被処理液体にレーザー 筋圧プレイクダウン (総縁破壊) を起こさせ、その作用 を利用するところが特徴であり、この点が従来のレーザー 利用技術と基本的に相違するととろである。すなわ ま、未実明では、レーザー続起プレイクダウン (総縁破 壊) の作用を利用しているのであって、単に、レーザー 光を液体に照射するのではない。光度の高いレーザー光 が集束され高エネルギー密度状態が達成されて初めて、 レーザーのブレークダウンが実更できるのである。この レーザーブレイクダウンが実更できるのである。この レーザーブレイクダウンが実更できるのである。この はしただけの場合とは異なる物理・化学現象が液体、 徳 や下起こり、それを利用して、効率の良い液体処理 を行うことが本発明の特徴である。

ない。

て詳しく説明する。レーザー光を集光し、局所的に非常 に高い電界強度が達成され、およそ1010 W/c m2 を 越えると、原子中の電子は、激しい振動が起こり、脱離 する。又、同時に分子の解離が起こり、プラズマ及びラ ジカルが形成されるのである。このときレーザーの集光 した部分に高圧力・高密度・高温状態が形成されるた め、それによる衝撃波も形成されるのである。更に、上 述のプラズマ、ラジカル、そして衝撃波の形成に伴っ て、UV光(その他、可視光や赤外光も当然発生してい る) の発生も起こる。この様な現象は、分子の多光子吸 収及び電子の高周波放電機構等の理論によって解説され ている。場合によっては、キャビテーションやX線の発 生が起こる場合がある。なお、従来のレーザー照射によ る処理 (特闘平8-57475号) でもレーザーの集光 が行われているが、レーザーの出力が僅か50Wである ため、レーザーブレイクダウンが起こるようなものでは

【0019】レーザープレイクダウンにおけるプラズマ 20 ・ラジカル・UV光・衝撃波の基本的作用を以下に述べ る。レーザーブレイクダウンの領域では、高密度の光工 ネルギーが集中し、高温・高密度・高圧力状態になり、 プラズマ・UV光・ラジカル・衝撃波が形成される。以 下、それぞれの作用について説明する。

プラズマ:プラズマ中にはイオン(正/負イオン)、電 子が存在し、原子や分子の高い励起を行い、固体物や有 機物の原子・分子の結合破壊、液体分子の解離、そして 光放出作用を行う。従って、高い化学的反応作用や副次 的に強力な加熱状態を発生する。特に、イオンの存在に 30 より、化学反応効果が著しく向上する。プラズマ中のイ オンとラジカルとしては、例えば水を考えると、H.O Hのイオンやラジカルが存在する。また、より強力なプ ラズマが発生する場合では、H, H₂, O, O₂, OH 種のイオンやラジカルが存在する。これらは、殺菌や細 胞膜の溶解に高い効果を発生する。

【0020】ラジカル:プラズマと光励起によって発生 する。主に、分子の解離と原子・分子の励起による活性 化によって形成されている。例えば、H2 O (水分子) では、HとOHに分解され、OHは、特に高い殺菌作用 40 と無機物・有機物の溶解作用を発生する。

U V 光:原子・分子の光励起及びプラズマ励起により、 発生する。UV光は殺菌効果を有する。また、固体や有 機物の原子間結合の緩和や破壊に効果を及ぼす。

衝撃波:衝撃波通過前後において、流体の圧力、密度、 温度の急激な変化を発生する。この急激な変化によっ て、殺菌、細胞膜等有機物の破壊、固体の破壊に効果を 及ぼす。このプラズマ・ラジカル・UV光・衝撃波は、 レーザーが集光された狭い領域、例えば、10×10μ m² の領域に集光されて、プレイクダウンが生じたとき 50

には、その領域だけに発生するだけではなく、その周囲 領域にまでその発生が起き、体積比で100倍以上の領 域まで、液体処理効果を及ぼすことができる。

【0021】本発明によるレーザーブレイクダウンを用 いて液体処理を行う場合の作用及びそれによる効果につ いて、さらに詳しく説明する。

1) レーザーブレイクダウンを用いて液体処理を行う

と、非接触で液体を処理することが可能である。つま

り、水中パルス放電のように、液体中における電極等の 固体物が不要である。また、この工程においては化学薬 品等の混入物が不要である。つまり、例えば、従来の水 中放電や機械式処理方式で必要となる電極の腐食や溶け だしによるメンテナンスや金属回収や薬液分離等の後処 理等の工程を不要または簡略化でき、コストや効率に高 い効果を与える。本発明では、レーザー光の入射だけが 液体中に行われるため、その制御は全て処理される液体 とは分離された場所で行うことができる。従って、制御 が液体に関係なく行えるので制御性が良い。電極や薬品 が必要なものでは、液体中での電極表面状態や薬品の混 合状態・反応状態に大きく影響される制御系となるの で、制御性が本発明と比較して悪い。

【0022】2) レーザーブレイクダウンによって、ブ ラズマ・ラジカル・UV光・衝撃波が発生する。これら を利用して、液体処理を行う。 これらの効果を利用する と、レーザーが集光された狭い領域に限らず、レーザー 集光領域の周囲に影響が及ぶため、有効な影響領域を拡 大することができる。図8に、レーザーブレイクダウン の原理図を示す。レーザー2が集光され、集光部6に集 光スポットAが形成され、そこで高エネルギーによりレ ーザープレイクダウンが生じるが、その周囲にプラズラ 牛成領域 R. ラジカル牛成領域 C、さらにその外側に衝 撃波領域Dが形成され、周囲から衝撃波29が出て行 く。

3、4) レーザーを走査することにより、レーザーブレ イクダウンが発生する場所を変更することができるた め、処理される液体に対して、広い範囲の液体に効果を 及ぼすことができる。つまり、大面積、大容量の処理を 効率よく行うことができる。近年では、レーザーのパル ス発振は、10KHz~1MHz程度まで可能となって おり、この技術を利用すると、レーザーブレイクダウン を10KHz~1MHzで行えるのである。つまり、1 秒間に、10000回~1000000回レーザーブレ イクダウンを起こすことができ、走査により場所を少し ずつ変化させることにより、液体の全領域に処理効果を 及ぼすことが可能となるのである。

【0023】 このとき、特にQスイッチングジャイアン トパルスレーザーを用いると効率的である。Qスイッチ ングジャイアントパルスレーザーでは、ピーク値の高い レーザー発振が可能となるため、より高いエネルギー密 度を実現することが可能となる。例えば、ルビーレーザ

10

【0024】5)レーザーとして、無外線レーザーを用いることができる。紫外線レーザーとして、例えば、エキシマレーザー、ルビーレーザー、窒素レーザー、Nd:YAGの高階線(4倍接)レーザー等を用いること 20ができる。この様に、レーザーブレイクダウンを起こすレーザー自体が紫外線であると、比較的に、液長のエネルギーが高く、容易にレーザーブレイクダウンを起こしやすい。また、紫外線効果による液体処理をより効果的に行うことができる。例えば、数盤や予痰処理をより加集的に行うことができる。例えば、数盤や予痰処理を対しては、レーザーとして紫外線レーザーを用いるとぞれ自体が紫外線殻選作用や細胞ダメージ作用を発揮するので、より効率的である。

【0025】6)レーザーとして、太陽光動起のレーザーを用いることができる。これにより、エネルギー効率 30 が飛躍的に高まり、低エネルギー供給のレーザー液体処理システムの実現ができる。レーザー発展器では、通常、ランプ励起や放電が多い。この使用電力を少なくするため、本発明では太陽光動起のレーザー発展器を用いるのが好ましい。

Nd: YAGレーザー等の個体レーザーやCO2 等のガ スレーザー等では、この様な太陽光筋起レーザー発展器 の実現が可能である。連続的な処理を行うシステムで は、ランプ筋起との併用方式を用いる。また、晴れた日 の処理ですり頻度であれば、太陽光筋起システムのみで 40 も良い。

【0026】7)被処理療体として細菌を含有している 液体を処理する場合には、強力な殺菌効果を得ることが できる。単に、UV光の照射やレーザー光の照射に比 べ、高密度のレーザーエネルギーを与えて処理できるだ けでなく、付随して発生するプラズマ・ラジカル・UV 光そして衝撃後を併用する処理となる。また、液体中に 電極などの固体物及びその溶り出しによる悪影響がな い。また、この工程では薬品の使用がないので、後処理 工程も簡便となるなどコストや効率の面でメリットが大 50 きい。

【0027】8) 汚泥を含有する溶液の処理において は、従来の脱水処理の問題点は、脱水率を上げることが できないことである。この主な原因は、付着している微 生物の細胞が破壊されず細胞液が脱水できないことであ ると考えられている。本発明では、強力な細胞破滅効果 を有するため、効率よく汚泥含有の液体処理を行うこと ができる。レーザーブレイクダウンでは、高密度のレー ザーエネルギーを与えて細胞破壊処理を実現するだけで なく、付随して発生するプラズマ・ラジカル・UV光・ 衝撃波を利用して、レーザー集光域の周辺にまで、強力 な細胞破壊効果を及ぼすことができるのである。また、 レーザーを走査して、処理領域を拡大することができる ので、効率の良い大量処理が可能となる。本発明では、 このレーザープレイクダウンによる方法により、通常の 機械式処理方法に比べて、脱水効率が150~200% ないしそれ以上向上するという優れた結果が得られた。 【0028】9) レーザープレイクダウンを用いて液体 中で固体物の破壊処理を行うと、破壊物の飛散を押さえ ることができるなどのメリットがある。従来、電極によ る電気パルス放電による衝撃波がこの破壊処理に用いら れている。このとき、電極の腐食・破揚・電極材料の恣 けだしが問題となり、後処理工程を煩雑化させる要因と なる。本発明のように、レーザーブレイクダウンによる と、それによって発生する衝撃波のみでなく、直接レー ザーエネルギーを被破壊物に照射でき、より緻密な破壊 が可能となる。また、電極のメンテナンスが不要であ る。非接触で作用できる制御性が良い。後処理工程が簡 便となる等のメリットがある。本発明では、この固体物 としては、具体的には、パソコン、車などをチップ化し た処理物 (大きさ10×10 cm) やコンクリート塊 (大きさ数×数 c m) などが考えられる。これらの破砕 分解により、例えば I C チップより金の回収を行った り、コンクリートと鉄筋を分離して、鉄筋を同収するこ となどを行う。また有害物(例えば I Cチップや回路な どに用いられたナマリやGaAs等)を分離して、外界 に拡散しないように回収処理を行うことができる。 【0029】10)レーザーブレイクダウンを用いて、 水生生物含有溶液の殺傷処理や海岸壁に付着する目等の 付着防止において、著しい効果を発揮することができ る。レーザープレイクダウンによると、水生生物に対し て強い殺傷ダメージを与えることができるので、特に稚 生物への強い殺傷ダメージを与えることができる。ま た、成長した貝などの付着防止には、身体ダメージを与 えることができる。また、走杏により、任意の領域に昭 射できるので、処理したい流体量の全てに対して均一に 効果を及ぼすことが出来る。これらは、レーザーブレイ クダウンによる衝撃波を主に用いて効果を発生できる。 また、薬品や電極などを用いないので、それらによる水

質汚染の心配もない。

[0030]

【実施例】以下実施例により本発明を具体的に説明する。ただし、本発明はこれらの実施例のみに限定されるものではない。

【0031】実施例1

図1に実施例1の概要を示す。図1では、レーザー発振 器1から出たレーザー2は集光ミラー3で集光され、容 器5内の液体4中で集光部6を形成し、レーザープレイ クダウンを起こし、その周囲にプラズマ等を生起した活 件領域7を形成する。レーザーとしては、パルス発振の 10 CO2 レーザー、発振波長10.6 μm、ビーム径30 mm、1kW~10kWの出力制御可能、10~1kH zのパルス発振が可能であるものを使用した。レーザー 発振器から発振されたビームは、集光ミラーによって容 器内の溶液中に導かれて集光する。前記容器内には、殺 菌処理又は汚泥処理をするための溶液が入っている。こ の溶液中に該レーザー集光によって、下記に示す大きさ の高エネルギー密度に達することにより、ブレイクダウ ンがパルス的に起こり、それによって、プラズマ・ラジ カル・UV光・衝撃波が生じる。これらの作用によっ て、 液体処理が行われる。

【0032】無光領域は、直径 650μ m領域で、光強度は3.6TW/cm²以上となる。この高エネルギー密度によって液体のプレイクタウンがおきて、上途のプラズマ・ラシカル・UV光・衝撃設が生じる。これらは、無光領域よりも広い領域にまて到達し、プラスマが、休頼率で100~1000倍、ラジカルが、1000倍~10000倍軽減は、達することが出来る。また、UV光・倍軽減と、100000倍以上の領域にまで到達する。この様な現象の複合効果により、有効な20代用領域が広がり、容器全体に対して、作用を及ぼすことが出来る。また、作用が優したがし、次光・大学系を移動させて、容器内液体全体に作用を及ぼすことが出来。

【0033】こで中肌・るレーザーとしては、CO2 レーザーに代えて、COレーザー、YAG(Nd:YAG)。 リーボース A 「イオンレーザー、ガラスレーザー、エキシマレーザー、ルビーレーザー、N2 レーザー、チタンサファイアレーザー、目り素レーザー、H2 Oレーザー、HFレーザー、色楽レーザー、半導体レーザー等 40 を用いても同様に行うことができる。処理した液体として、下記の2種の場合を示す。

- 1) 水の殺菌の場合:水には酵母菌・放練菌・糸状菌・ 細菌・原生植物・薬類等が含まれている。この様な水に 上述のレーザーブレイクダウンを行い、殺菌を行うこと が出来る。
- 2) 汚泥処理の場合: 水溶液に汚泥が含まれている。脱水処理の前に、上述のレーザーブレイクダウンによる微生物の細胞破壊を行い、脱水効率を飛躍的に上げることが出来る。汚泥の脱水においては、通常の機械式脱水機 so

を用いたときの脱水ケーキを対象とする際の脱水率は重 星期合で、上水を対象とする場合80~60%、下水を 対象とする場合85~70%であるが、これらにレーザ ープレイクダウンを行ったときには、汚泥の脱水効率は 前記の場合に比して150~200%向上する。

[0034]実施例2

図2に示すように、汚泥を含む水溶液又は殺債を行う必要のある水が間路に流されているときに、集形したレーザーにより、サーザープレイクタウンを起こさせて、汚泥処理又は殺菌処理を行う。図2において、レーザー発振器とない。 (大き) 大田 (

【0035】図2に示すように、放出されたレーザー2 は、ハーフミラー9によって2つのビームに分かれて、 2 ケ所で液体処理を行う。これは、繰り返し処理を行う ことで、より処理レベルを上げるためである。ハーフミ ラー9によって反射された一つのビームが集光・走査ミ ラー10で反射して、ビームの集光を行う。このとき、 集光・走査ミラー10の走査を行い、流路を流れる液体 に漏れなくプレイクダウンの効果が及ぶようにする事が 出来る。また、残りのビームは集光・走査ミラー11で 反射して、ビームの集光を行い、ミラーの走査により同 様に流路を流れる液体に漏れなくプレイクダウンの効果 が及ぶようにする事が出来る。この図は、断面ではある が、実際には流路の断面に対して、走査を行うので、図 3の斜視図にみる様に処理を行うことが出来る。この図 では、プレイクダウンを場所を変えて行い単位時間に流 れる液体の全てにプレイクダウンによる処理効果を及ぼ すことが可能となる。これは、流速、焦点距離、走査速 度の制御により可能となる。

【0036】また、より処理効果を高めるため、多重処理を行うための光学系が設けられている。それが、2段目(下流機)のレーザーブレイクダウンである。ビームの走査及びプレイクダウンは上述と同様に行う。レーザーとして、より高出力のエキシマレーザーを用いて、効果を向上させることもできる。また、コストを低く押さえるために、CO2レーザーやイスロレーザーを用いることもできる。図4の方式を用いることもできる。この方法では、演路袋り機構15により流体の通過面積を小くする。液体が適上に直後付近にレーザーブレイクダウンを行いかつビームの走査を行う。液体が終られた

断面積を通過してくるので、狭い領域のプレイクダウン をビーム走査を行うことにより、通過する液体に対して 漏れなくプレイクダウンの効果を与えることが出来る。 流路が絞られることにより液体の流速が早くなるが、レ ーザーの走走速度に比べると無視できる。

【0037】実施例3

この実施例は、レーザー発振器に、太陽光励起とランプ 励起の併用によるハイブリッドシステムレーザーを用い ることが特徴である。実施例1及び2の様な例に対し て、このハイブリッドシステムのレーザーを用いると、 使用電力が著しく減らすことが出来るので、より低コス ト化を実現できる。レーザーは、Nd:YAGレーザー であるYAGレーザーの励起を太陽光で行うため、図5 に示すように、太陽光集光器17及び反射ミラー18を 用いて、太陽光16を集光し、YAGレーザー共振器ミ ラー1からYAGロッド21に導入し、光励起を行う。 励起されたYAGロッド(又はスラブ)21中の金属イ オンN d はレーザー波長の1.06 μ m波長の光を放出 し、レーザー共振器22の第1共振器ミラー及び第2共 振器ミラー (図示せず) によって、光が誘導放出によっ 20 て増幅されレーザービームが第2共振器ミラーより放出 される。第2共振器ミラーには、Qスイッチジャイアン トパルスレーザー発振のための機構が設けられている。 従って、放出されるレーザービームはQスイッチジャイ アントパルスレーザーである。また、太陽光不足によっ て太陽光励起によるレーザー出力が不足する場合には、 ランプ励起を併用して、必要な出力を達成することがで きる。

[0038] この様にして放出されたレーザーは反射ミラー8と集光用ミラー3によって集光され、酸集光部が 30 核処理液体 中に導かれる。この液体中の東光能において、ブレイクダウンが起こり、ブラズマ・ラジカル・U V光・衝撃波が発生して、液体の処理を行う。 処理としては、殺遣、汚泥処理を行うことが出来る。このとき、ビームの走まや光学系の移動機構を設けて、液体全体に処理効果を及ばすことも可能である。

【0039】実施例4

10003月 大阪田内は 生物付着附近や実施例である。図6に示すように、発電 所や工場などの取水口23付近において、水生付着物の 浮遊生活所効生を殺傷し、取水流路における水生生物の 40 付着を防止する。水生生物として、カキ・ムラウキガイ ・ふじつぼ巻が対象として考えられる。CO・レーザー やNd:YACレーザーのQスイッチジャイアントバル スレーザーを開いる。集光ラー、集光・走査ラーや 集光レンズを用いてレーザーピームを集光してプレイク ダウンを起こす。このときビームの主意を行うことによ って処理領域の拡大や効果の向上を行うことができる。 また、ランブ励起と太陽光励症のハイブリッドシステム 20・ザーを用いることによって、鴨れた日は海岸新起 14 方式を行い、また、太陽光励起で出力の不足する場合に は、ランプ励起を併用して、使用電力を低減することが できる。

【0040】実施例5

水中における固体物破砕の例である。図7に示すよう に、液体(水)中に試料台27の上に被破砕物28が設 置され、集光レンズ25により該被破砕物28に集光さ れたレーザービームを照射して被破砕物28の破砕を行 う。このとき、移動機構26により集光部の位置移動別

郵を行う。被破砕物付近から位置を移動して、被破砕物の中心部に徐々に集光部の移動を行う。これは、先ず被 破砕物が近においてプレイクダウンを行い主に衝撃波に おいて大面に鬼恐を発生させ、プレイクダウン発生位置 を被破砕物中心部に移動させることにより、より効果的 な破砕を行う。レーザーとしては、実施例1 ~ 4までに 述べた様なレーザーを用いることが出来る。特に Q スイッチジャイアントパルスレーザーを用いると効果的・効率的である。

[0041]

- 【発明の効果】本発明によれば、レーザーブレイクダウンにより、プラズマ・ラジカル・衝撃波などの発生を伴うため、下記のような優れた効果が得られる。
 - ① 汚泥の脱水処理を行った場合、脱水効率が従来に比べて150~200%ないしそれ以上と優れた効率が得たれる。
 - ② 殺菌のために行った場合、殺菌効率が高い他、広い 範囲に作用し、幅広い流路を流れる液体について高い殺 菌作用を与えることができ、多量の薬品を使用する必要 は全くない。
- ③ 生物付着防止処理についても、強い作用をし、かつ 広い範囲に作用し、スキャンニングすれば相当広い範囲 について、生物付着防止の効果が得られる。

④ 固体物破壊の作用も有しており、有害物或いは有価物を含むものから、有価物を回収したり、有害な物質を外界に出さないようにすることが容易にできる。

⑤ 使用する電力は水中パルス放電などに比すると、若 しく少なく、薬品を使用する必要がなく、電極に使用し た金属の溶け出し等の問題もない。

【図面の簡単な説明】

40 【図1】レーザーを液体中に集光してレーザーブレイク ダウンを起こす説明図を示す。

【図2】レーザーを2箇所以上に分けて集光して流れる 液体中にレーザープレイクダウンを起こす説明図を示

【図3】図2における流路の液体に対するレーザーの集 光部の移動状態を説明する斜視図を示す。

【図4】流路に液体に対する流路絞りを設置した場合の レーザーブレイクダウンの生起状態の説明図を示す。

【図5】太陽光励起レーザーを用いた場合のレーザー照 射状況の説明図を示す。

【図6】冷却水などの取水口にレーザー照射を行う場合 のレーザー照射状況の説明図を示す。

【図7】水中における固形物破砕を行う場合のレーザー 照射状況の説明図を示す。

【図8】 レーザーブレイクダウンの原理図を示す。

【符号の説明】

- 1 レーザー発振器
- 2 レーザー
- 3 集光ミラー
- 4 液体
- 5 容器
- 6 集光部 7 活性領域
- 8 反射ミラー
- 9 ハーフミラー
- 10 集光・走査ミラー
- 11 集光・走査ミラー
- 12 液体の流れ

活性領域 秦允郭

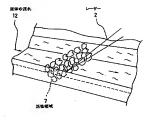
- 13 液面
- 14 走查

- 15 流路絞り
- 16 太陽光
- 17 太陽光集光器
- 18 反射ミラー
- 19 励起光の入射
- 20 励起用ランプ
- 21 レーザーロッド
- 22 レーザー共振器
- 23 取水口
- 24 パルスレーザー 25 集光レンズ
- 26 移動機構
- 27 試料台
- 2.8 被破砕物
- 29 衝撃波 A 集光スポット
- B プラズマ生成領域
- C ラジカル生成領域
- D 衝擊波生成領域

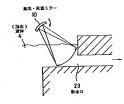
[231]

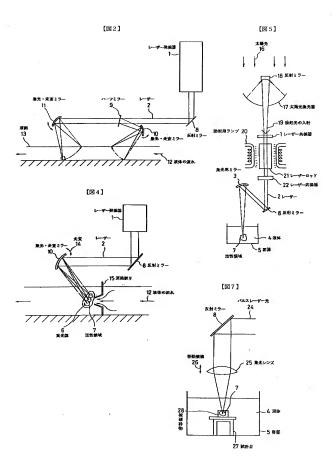
レーザー発接非

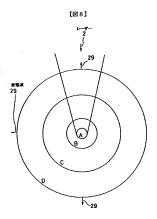
[図3]



[図6]







フロントページの続き

(72) 発明者 五十嵐 千秋 神奈川県藤沢市本藤沢4丁目2番1号 株 式会社在原総合研究所内

(72)発明者 山内 和雄

神奈川県藤沢市本藤沢4丁目2番1号 株式会社荏原総合研究所内

F ターム(参考) 4D037 AA12 AB03 BA16 BA18 BB01 4D059 BK11 BK13 BK23 BK24 BK25

CA21

4D067 CD05 GA20